

# 物體表面高度、角度及其變化之量測系統

## 本院覽號

02A-940705

## 公告日期

## 智財權狀態

台灣(發明)I 264520放棄維護、美國7247827 B1已獲證、美國US7247827 B1已獲證

## 摘要

本創新量測機制之光路架構可同時針對物體位置平移與兩軸角度偏折變化作非接觸式之精密量測，可應用至原子力顯微鏡(Atomic Force Microscope)、奈米測距、奈米定位系統、超精密定位回饋訊號偵測、大面積樣品形貌之奈米級檢測。

## 技術優勢

製作成本低廉。比同級產品更高之定位解析度。體積小不佔空間。

## 應用範圍

半導體、顯示器、精密光學、奈米粉體、奈米材料、光碟製造、生物醫學、或微機電等。

## 創作人

黃英碩、胡恩德、黃光裕



中央研究院  
ACADEMIA SINICA